

Л и т е р а т у р а

- [1] Грибковский В. П. Теория поглощения и испускания света в полупроводниках. Минск, 1975. 464 с.
- [2] Блэкмор Дж. Статистика электронов и дырок в полупроводниках. М., 1964. 392 с.
- [3] Vashista P., Kalea R. K. — Phys. Rev. B, 1982, v. 25, N 10, p. 6492—6495.
- [4] Лукашевич П. Г. — ФТИ, 1983, т. 17, в. 2, с. 374—375.

Белорусский политехнический институт
Минск

Получено 16.05.1988
Принято к печати 2.08.1988

ФТП, том 23, вып. 3, 1989

НОВЫЙ ТИП ОСЦИЛЛЯЦИИ КИНЕТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В КВАНТОВЫХ СТРУКТУРАХ

Ляпилин И. И., Карягин В. В.

В последние годы объектами интенсивного исследования стали так называемые композиционные квантовые ямы (ККЯ) — гетероструктуры, содержащие сверхтонкие слои, в которых существенно размерное квантование энергии носителей заряда. Глубина ККЯ для электронов (дырок) определяется в основном разностью между минимумами зоны проводимости (максимумами валентной зоны) полупроводниковых компонент, образующих ККЯ, и является величиной, слабо зависящей от внешних воздействий.

Представляет интерес исследовать свойства двумерных носителей в квантовых ямах, глубину которых можно варьировать в широких пределах (вплоть до исчезновения квантовой ямы). Реализация такой квантовой структуры возможна, если исходная структура в качестве одной из компонент будет содержать узкощелевой полумагнитный полупроводник (ПМП). Рассмотрим, например, структуру, состоящую из твердых растворов ПП—ПМП—ПП, где ПП — компонента обычного, а ПМП — компонента полумагнитного полупроводников. Будем считать, что составы твердых растворов ПП и ПМП подобраны таким образом, что в отсутствие магнитного поля H в этих компонентах одинаковы значения запрещенной щели ϵ_g , а следовательно, и величины эффективных масс ($m \sim \epsilon_g^{-1}$). В отсутствие внешнего магнитного поля такая структура не будет обладать «аномальными» свойствами.

При помещении такой структуры во внешнее магнитное поле наряду с орбитальным квантованием энергетического спектра в ПМП компоненте будет иметь место дополнительная перенормировка энергетического спектра, обусловленная обменным взаимодействием зонных носителей заряда с локализованными моментами примеси замещения [1]. В результате этого в исходной структуре в ПМП компоненте будет реализоваться спиновая квантовая яма (СКЯ), глубина которой будет зависеть от следующих величин: температуры, магнитного поля, величины обменного взаимодействия и содержания переходного элемента в ПМП компоненте. Для составов с $\epsilon_g < 0$ для глубины СКЯ имеем

$$\Delta \sim \beta N_0 x \langle S^z \rangle \sim HT^{-1}, \quad (1)$$

где β — обменный параметр, N_0 — число элементарных ячеек в единице объема, $\langle S^z \rangle$ — среднее значение локализованного спина.

Следует подчеркнуть принципиальное отличие СКЯ от ККЯ. Для реализации ККЯ необходимо различие химических потенциалов в исходных компонентах, в то время как для СКЯ химические потенциалы в исходных полупроводниковых компонентах одинаковы.

Ограничимся для краткости рассмотрением только электронной СКЯ. Будем считать, что магнитное поле направлено перпендикулярно слою ПМП

ширина которого W порядка длины волны Де Броиля. Аппроксимируя СКЯ прямоугольной ямой глубиной Δ , для энергии размерно-квантованных уровней в СКЯ имеем

$$\epsilon_N = \frac{2\hbar^2 c_N^2}{mW^2}, \quad (2)$$

где ζ_N являются корнями уравнения

$$\arcsin \gamma \zeta = N\pi/2 - \zeta, \quad \gamma = (2/m\Delta)^{1/2}/W; \quad N = 1, 2, 3 \dots \quad (3)$$

Как следует из (2), (3), количество размерно-квантованных уровней в СКЯ определяется ее глубиной и шириной. Анализ показывает, что при реальных параметрах в СКЯ могут быть реализованы один или два размерно-квантованных уровня.

С увеличением температуры (при фиксированном магнитном поле) глубина СКЯ будет уменьшаться, при этом размерно-квантованные уровни энергии

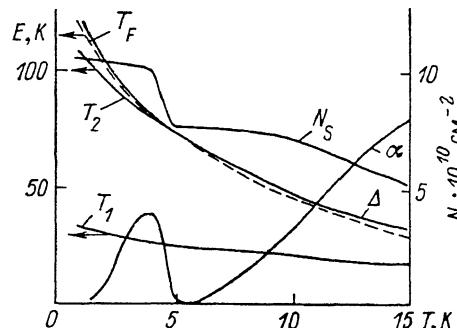


Рис. 1. Зависимость от температуры энергии размерно-квантованных уровней T_1 , T_2 , энергии Ферми T_F , глубины СКЯ Δ , концентрации N_s и термоэдс α 2D-электронов.

$W=400 \text{ \AA}$, $\beta N_0=1.5 \text{ эВ}$, $T_0=7 \text{ К}$, $S_0=1.5$, $H=30 \text{ кЭ}$, $N_D=5 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$.

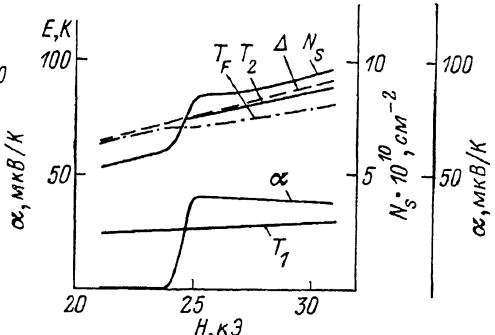


Рис. 2. Зависимость от магнитного поля энергии размерно-квантованных уровней T_1 , T_2 , энергии Ферми T_F , глубины СКЯ Δ , концентрации N_s и термоэдс α 2D-электронов в СКЯ.

$T=5 \text{ К}$, $W=400 \text{ \AA}$, $S_0=1.5 \text{ эВ}$, $T_0=5 \text{ К}$, $\beta N_0=1.5 \text{ эВ}$.

будут выходить из СКЯ. И наоборот, с увеличением магнитного поля (при фиксированной температуре) глубина СКЯ будет возрастать, так что в ней может быть реализован новый размерный уровень энергии. Покажем, что в этих случаях кинетические коэффициенты 2D-электронного газа будут вести себя немонотонно.

Рассмотрим, например, изменение коэффициента поперечной термоэдс α . Выражение для α в интересующих нас условиях имеет следующий вид:

$$\alpha = \beta_{xy}/\sigma_{xy} = -S/|e|N_s, \quad (4)$$

где S , N_s — энтропия и концентрация 2D-электронного газа [1]. Используя явный вид для тензоров β_{xy} , σ_{xy} , перепишем выражение для α в удобном для численного анализа виде [2]

$$\alpha = -\frac{k}{|e|\nu} \sum_{n, N} \{ \ln(1 + e^{-x}) + xf(x) \}, \quad f(x) = [e^x + 1]^{-1}, \quad x = \frac{\epsilon_{n, N} - \epsilon_F}{kT}, \quad (5)$$

где ν — фактор заполнения, ϵ_F — энергия Ферми, $\epsilon_{n, N} = \epsilon_N + \epsilon_n$, $\omega_0 = eH/mc$, $n = 1, 2, 3 \dots$, $\sigma = \pm 1$, $\epsilon_n = \hbar\omega_0(n - 1/2 - \sigma/4)$.

Вычисление коэффициента поперечной термоэдс α проведем в сильном магнитном поле, когда $n=1$, $\sigma=+1$, при следующих значениях параметров, характерных для ПМП HgMnTe : $\beta N_0 \sim 1.5 \text{ эВ}$, $x \sim 0.03$. Величину $\langle S \rangle$ аппроксимируем выражением [3]

$$\langle S \rangle = S_0 B_s(y), \quad y = \bar{g} \mu S H/k(T + T_0), \quad (6)$$

где $\bar{g}=2$, $S=5/2$, $S_0=1.5$, $T_0=3 \text{ К}$, $B_s(y)$ — функция Бриллюэна,

Рассмотрим температурное изменение $\alpha(T)$, полагая $W=400\text{ \AA}$, $H=30$ кЭ.

Величину ε_F можно определить из уравнения электронейтральности, полагая, что все доноры ионизованы, а $N_A=0$:

$$N_D = 2N_V + N_S. \quad (7)$$

Здесь N_V — концентрация электронов в объеме ПП, а N_S — концентрация $2D$ -электронов в СКЯ:

$$N_S = v/2\pi\lambda^2 W, \quad (8)$$

λ — магнитная длина.

При выбранных нами параметрах в СКЯ реализуются два размерных уровня $\varepsilon_1, \varepsilon_2$. Увеличение температуры приводит к уменьшению ее глубины Δ , при этом уровень ε_2 выходит из СКЯ при $T \sim 4-5$ К. Концентрация $2D$ -электронов меняется плавно, когда уровни расположены в СКЯ, и испытывает скачок, связанный с выходом уровня ε_2 из ямы. Коэффициент термоэдс ведет себя при этом немонотонно (рис. 1).

Изменение $\alpha(H)$ с увеличением магнитного поля при фиксированной температуре ($T=5$ К) представлено на рис. 2. Из численного анализа следует, что с увеличением магнитного поля Δ растет. При этом начиная с поля $H \geq 25$ кЭ в СКЯ реализуется второй размерный уровень ε_2 , что приводит к резкому изменению концентрации $2D$ -электронов N_S . Термоэдс α при этом также резко изменяется.

Таким образом, в квантовых ямах с варьируемой глубиной возможны новые осцилляции кинетических коэффициентов $2D$ -носителей заряда, которые обусловлены немонотонным изменением концентрации двумерных носителей заряда в том случае, когда меняется число размерно-квантованных уровней в СКЯ.

Л и т е р а т у р а

- [1] Ляпилин И. И., Цидильковский И. М. // УФН. 1985. Т. 146. В. 5. С. 35—72.
- [2] Аскеров Б. М., Кулиев Б. М., Эминов Р. Ф. // ФНТ. 1977. Т. 3. В. 3. С. 344—349.
- [3] Streda P. // Phys. St. Sol. (b). 1984. V. 125. N 2. P. 849—860.

Институт физики металлов
УНЦ АН СССР
Свердловск

Получено 27.06.1988
Принято к печати 2.08.1988

ФТП, том 23, вып. 3, 1989

ВЛИЯНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИОДОВ С БАРЬЕРОМ ШОТКИ

Скупов В. Д., Цыпкин Г. А., Шенгурев В. Г.

Обработка высоким гидростатическим давлением (ОВГД) — один из новых и перспективных методов управления структурным совершенством и физическими свойствами полупроводниковых материалов и композиций [1, 2]. Однако накопленный к настоящему времени экспериментальный материал носит преимущественно отрывочный, несистематический характер, что не позволяет конкретизировать природу процессов, протекающих в полупроводниках в условиях гидростатического сжатия, и соответственно прогнозировать результаты воздействия давлением. Такая ситуация, в частности, обусловлена и тем, что круг исследовавшихся объектов пока незначителен и охватывает главным образом гомогенные полупроводниковые структуры (диффузионные, имплантированные слои и гомоэпитаксиальные композиции). Вместе с тем представляют интерес (и прежде всего с точки зрения практического использования позитивных возможностей ОВГД), изучение необратимых изменений структурно-чувствительных свойств гетерогенных композиций, подвергнутых обработке давлением. В настоящей работе приводятся результаты исследований влияния ОВГД